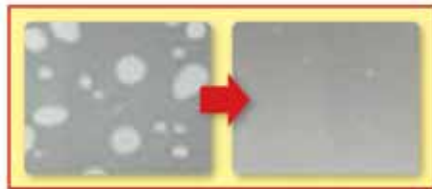


ギ酸還元・水素還元両対応!

タッチパネル式 卓上型 真空はんだリフロー装置 RSS-210-S

本装置は、基板やウエハー上の電極面や、銅ナノ粒子の表面にある、接合不良原因の酸化膜を、ギ酸の還元効果で簡単に除去します。



通常のリフローに加え、鉛フリー、ボイドレス、フラックスレスなどの各リフローが可能です。

- 卓上型サイズながら最大到達温度400℃を実現しました。(オプション時:最大到達温度:500℃)
- 最大200×200mm基板に対応します。
- 下面からのIP(赤外)ヒーターによる加熱で、正確で高速な加熱が行え、最高180K/minの高速昇温が可能です。
- タッチパネル式モニターを標準装備し、タッチ操作による簡単なオペレーションが可能です。



寸法: 430(W)×295(D)×290(H)mm



RSS-210-Sに
AZ9Cを取り付けて
使用します。

光学ズームマイクロスコープにより、
チャンバー内の観察・記録が可能!

10×光学ズームマイクロスコープ AZ9シリーズ

- 90mmの作動距離(WD)と光学10倍ズーム、3μmの分解能を実現しました。
- RSS-210-S本体に付いたのぞき穴(石英ガラス製10mm厚)を透過しても、シャープかつクリアに見えます。
- リフロー本体のプログラム運転と同期して観察できます。
- 観察データはデジタルカメラによりPCに保存できます。

UNTEMP ユニテンブジャパン株式会社
Universal Temperature Processes 〒194-0013 東京都町田市原町田2-6-13 ベルストーク1・2階
TEL:042-860-7890 FAX:050-3730-8404
https://www.unitemp.jp E-mail:sales@unitemp.jp

★詳細説明やデモのご希望など、お気軽にお問い合わせください。



第2回 **名古屋 ネプコン ジャパン**
エレクトロニクス開発・実装展

会期: 2019年9月18日[水]~20日[金]
会場: ポートメッセなごや

弊社ブース NO. 1-11

水素還元・ギ酸還元両対応!

卓上型 真空はんだリフロー装置 VSS-450-300

オプション搭載により
上面、下面両方からの
IR(赤外)照射に対応!

有効加熱エリア
300×300×50mm



最大到達温度450℃!
最高100K/min.の高速昇温

水冷方式を採用!
最大90K/min.の降温を実現

- フラックスレスはんだ(還元方式)・フラックス入りはんだ両対応
- 大気リフロー、窒素ガスパージリフロー、真空リフローに標準対応
- ギ酸還元リフロー、フォーミングガス(水素+窒素)リフローにオプションで対応可能
- 真空ポンプと組み合わせ、最大0.1Pa(10-3hPa)の真空環境が可能
- タッチパネル式モニターを標準装備、簡単なオペレーションが可能



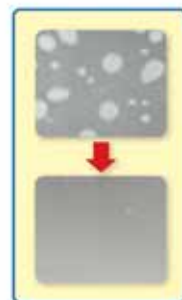
大気、窒素、真空、ギ酸還元、水素還元
などの各リフローに1台で対応!

タッチパネル搭載 多機能はんだリフロー装置 RVS-210

減圧環境で
ボイドを除去

ギ酸還元で
濡れ性確保

- 通常のリフローに加え、鉛フリー、ボイドレス、フラックスレスなどの各リフローが可能
- はんだリフロー装置としては余裕の最大到達温度400℃に標準対応
- 高速赤外(IR)ヒーターを装備し、最大毎分120℃(毎秒2℃)の高速昇温が可能
- 多彩なリフロープロフィール設定が可能
- チャンバー上部にのぞき窓を標準装備し、リフロー中の対象物の観察が可能
- タッチパネル式モニターを標準装備し、簡単なオペレーションが可能



UNTEMP ユニテンプジャパン株式会社
Universal Temperature Processes

〒194-0013 東京都町田市原町田2-6-13 ベルストーク-1
TEL:042-860-7890 FAX:050-3730-8404 E-mail:sales@unitemp.jp

詳細説明やデモのご希望など、お気軽にお問い合わせください。

<https://www.unitemp.jp>